



Рис. 1. СЭМ-фотографии поверхности покрытий Ni – Sn толщиной 1 мкм (а, з, е), 5 мкм (б, д, ж) и 10 мкм (в, з), осаждаемых из хлоридно-фторидных электролитов № 1 (а – в), № 2 (з, д) и № 3 (е – з) при плотности тока 0,5 А/дм²

Fig. 1. SEM images of the surface of Ni – Sn coatings with the thickness of 1 μm (a, d, f), 5 μm (b, e, g) and 10 μm (c, h) deposited from chloride-fluoride electrolytes No. 1 (a – c), No. 2 (d, e) and No. 3 (f – h) at the current density 0.5 A/dm²